# Кинетика фазовых превращений при термическом отжиге в тонких золь-гель-пленках РZT

© В.Я. Шур, Е.Б. Бланкова, А.Л. Субботин, Е.А. Борисова, А.В. Баранников

Научно-исследовательский институт физики и прикладной математики при Уральском государственном университете, 620083 Екатеринбург, Россия

E-mail: Vladimir.Shur@usu.ru

#### (Поступила в Редакцию 24 августа 2000 г.)

Исследованы изменение морфологии поверхности и кинетика фазового превращения в золь-гель тонких пленках цирконата-титаната свинца (PZT) в процессе быстрого термического отжига с помощью in situ измерений интенсивности отраженного рассеянного света и регистрации последовательных мгновенных изображений, полученных с помощью оптического микроскопа. Кроме того, изучалось изменение степени совершенства текстуры, доли растущей фазы и угловой зависимости интенсивности рассеянного света в частично отожженных образцах. Параметры, характеризующие кинетику фазового превращения пирохлор-перовскит, извлекались с помощью математической обработки экспериментальных данных. Показано, что кинетика фазового превращения и кристаллическая текстура пленок существенно зависят от температуры пиролиза. Рассмотрен механизм формирования текстуры.

Работа выполнена при частичной поддержке программы "Университеты России: фундаментальные исследования" (грант № 5563), Министерства образования РФ (грант № 97-0-7.1-236) и Американского фонда гражданских исследований и развития независимых государств бывшего Советского Союза (грант № REC-005).

В последние годы для изготовления сегнетоэлектрических тонких пленок широко используются химические методы. Наибольшее распространение для получения пленок высокого качества получили методы золь-гель и разложения металлоорганических соединений. Во всех этих методах для кристаллизации и получения соответствующей фазы используется термическая обработка аморфных пленок. Отжиг золь-гель-пленок цирконататитаната свинца Pb(Zr,Ti)O<sub>3</sub> (PZT) приводит к формированию фазы перовскита (обладающей сегнетоэлектрическими свойствами) через промежуточную фазу со структурой типа пирохлора.

Известно, что условия термической обработки существенно влияют на микроструктуру [1-3] и сегнетоэлектрические характеристики пленок [4]. Очевидно, что кинетика формирования промежуточной фазы при кристаллизации и в процессе фазового превращения пирохлор-перовскит существенно зависит от скорости нагрева. Было показано, что наилучшие сегнетоэлектрические характеристики пленок получаются при термическом отжиге с высокими скоростями нагрева ("быстром термическом отжиге") [5]. Однако практически отсутствуют результаты in situ исследований кинетики кристаллизации/ фазовых превращений при быстром термическом отжиге из-за недостаточного разрешения по времени традиционных методов. In situ исследования с помощью рентгенографических измерений [6] и спектроскопической эллипсометрии [7] проводились только для медленной кристаллизации/фазового превращения. Нами развит метод, основанный на in situ измерении интенсивности упругого рассеяния света, чувствительный к мгновенным изменениям формологии поверхности и обладающий достаточно высоким разрешением по времени [8–11]. Предложенный метод математической обработки экспериментальных данных позволяет извлечь информацию о кинетике фазового превращения [10].

В настоящей работе метод рассеяния света использован для детального исследования эволюции морфологии поверхности золь-гель-пленок РZT при изотермическом отжиге с быстрым нагревом. Показано, что анализ экспериментальных данных позволяет получить основные параметры, характеризующие кинетику формирования текстурированного перовскита в РZT. Для проверки адекватности интерпретации полученных результатов оптические измерения были сопоставлены с традиционными рентгенографическими исследованиями частично отожженных пленок.

#### 1. Методика эксперимента

Изучалась кинетика фазового превращения при изотермическом отжиге с быстрым нагревом в пленках Pb<sub>1.1</sub>( $Zr_{0.47}Ti_{0.53}$ )O<sub>3</sub> (110/47/53) с 10% избытком Pb для компенсации его потерь при отжиге. Рентгеноаморфные пленки толщиной 400–600 nm наносились на подложки Pt/Ti/SiO<sub>2</sub>/Si с эпитаксиальным слоем платины (толщиной около 200 nm). Исследовались две партии пленок, изготовленных в идентичных условиях и различающихся температурами пиролиза ( $T_{pyr}$ ): 380 и 490°С.

В работе использовался изотермический отжиг (в интервале температур от 600 до 750°С) при скорости нагрева около 100°С/s. Непосредственно в процессе отжига измерялась интегральная интенсивность рассеянного света в диапазоне углов 2–30°С и с использованием видеозаписи фиксировалась последовательность мгновенных изображений гетерофазной структуры, пролученных с помощью оптического микроскопа. Для сопоставления результатов оптических измерений с другими экспериментальными методами и измерения угловых зависимостей рассеянного света проводились исследования на частично отожженных образцах, представлявших собой фрагменты одной пластины, которые отжигались при различных условиях.

Для исследований рентгеноструктурных характеристик частично отожженных пленок в режиме съемки  $\theta - 2\theta$  (Со $K_{\alpha}$ ) снималась дифракционная картина в интервале углов от 20 до 65° при комнатной температуре. Измерялись зависимости интенсивности текстурного максимума перовскита (111), интегральной интенсивности максимума пирохлора (222) и интегральной интенсивности максимумов нетекстурированного перовскита (011), (001) и (002) от времени отжига.

Различие коэффициентов преломления фаз перовскита и пирохлора позволяло визуализировать пространственное распределение фаз с помощью оптического микроскопа [12]. Сравнение результатов измерений интенсивности рассеянного света с изображениями поверхности пленок, полученными с помощью оптической и электронной микроскопии, показало, что 1) рассеяние света на границе нижний электрод-пленка и в объеме пленки пренебрежимо мало, 2) измеряемые угловые зависимости чувствительны только к изменениям морфологии поверхности [13,14].

### 2. Экспериментальные результаты

Для подробного исследования кинетики фазового превращения проводились частичные отжиги длительностью от 15 s до 16 min. Низкая температура отжига  $T_{\rm an} = 600^{\circ}$ С позволяла обеспечить воспроизводимость условий даже на быстрой начальной стадии процесса.

Сравнение результатов оптических и рентгеноструктурных исследований показало, что зависимости от времени отжига интенсивности текстурного максимума и интегральной интенсивности рассеянного света подобны (рис. 1). Эти зависимости могут быть разделены на две стадии экспоненциального роста с существенно различными постоянными времени (рис. 1). Для образцов с  $T_{\rm pyr} = 380^{\circ}$ С стадия "быстрого роста" продолжается в течение 60 s с постоянной времени  $\tau_f \sim 12$  s. На стадии "медленного роста" постоянная времени  $\tau_s$  составляет 880 s.

Прямые наблюдения за изменением морфологии пленок при отжиге показали, что различным стадиям роста соответствует различная геометрия растущих областей, занятых зернами перовскита. На стадии быстрого отжига наблюдались рост и слияние изолированных областей, а при переходе к стадии медленного роста формировалась лабиринтная структура.



**Рис. 1.** Зависимости от времени отжига интенсивности рентгенографического текстурного максимума фазы перовскита (111) (*a*) и интегральной интенсивности рассеянного света (*b*). Экспериментальные точки аппроксимированы экспоненциальными зависимостями.  $T_{an} = 600^{\circ}$  С,  $T_{pyr} = 380^{\circ}$  С.

Полученные зависимости от времени отжига интегральной интенсивности рассеянного света  $I_{\rm sc}$  и интенсивности текстурного максимума фазы перовскита  $I_{(111)}$  аппроксимировались модифицированной формулой Колмогорова–Аврами [15–17] для кинетики двумерного роста по  $\alpha$ -модели (при постоянных интенсивности зародышеобразования и скорости роста) с учетом геометрической катастрофы (уменьшения размерности роста)

$$I(t) = \begin{cases} I_0 + \Delta I_f \{ 1 - \exp[-(t - t_d)^3 / \tau_{f\alpha}^3] \}, \ t < t_{\text{cat}}, \\ I_0 + \Delta I_s \{ 1 - \exp[-(t - t_d)^2 / \tau_{s\alpha}^2] \}, \ t > t_{\text{cat}}, \end{cases}$$
(1)

где  $t_d$  — время задержки,  $t_{cat}$  — время катастрофы,  $\tau_{f\alpha}$  и  $\tau_{s\alpha}$  — постоянные времени для стадий быстрого и медленного роста соответственно.

2.1. Исследования образцов с низкой температурой пиролиза. Рентгенографические исследования показали, что в исходном состоянии (*T*<sub>pyr</sub> = 380°C) пленка РZT представляла собой смесь аморфной и пирохлорной фаз (рис. 2, *d*).

Весь процесс фазового превращения при термическом отжиге разделяется на три стадии: задержки, быстрого роста и медленного роста.

На стадии задержки не образуется фаза текстурированного перовскита (рис. 2, b) и практически не меняется интенсивность рассеянного света, связанная с изменением морфологии поверхности пленки  $I_{sc}$  (рис. 2, c). Рентгенографически обнаружен значительный рост количества пирохлора (рис. 2, a). Появление и медленный рост небольшого числа кристаллитов нетекстурированного перовскита наблюдались с помощью оптического микроскопа и рентгенографически. Этот рост, по-видимому, связан с кристаллизацией на дефектах.



**Рис. 2.** Зависимости от времени отжига интенсивности рентгенографического максимума фазы пирохлора  $I_{(222)}(a)$ , интенсивности рентгенографического текстурного максимума фазы перовскита  $I_{(111)}(b)$  и интегральной интенсивности рассеянного света  $I_{sc}(c)$ . Схема основных стадий эволюции морфологии пленки в процессе отжига: d — исходное состояние пленки после пиролиза (I), e — стадия задержки роста (D), f — быстрого роста (F), g — медленного роста (S).  $T_{an} = 600^{\circ}$ С,  $T_{pyr} = 380^{\circ}$ С. 1 — дефекты, 2 — пирохлор, 3 — текстурированный перовскит, 4 — нетекстурированный перовскит.

Быстрая стадия процесса соответствует быстрому росту количества текстурированного перовскита и уменьшению количества пирохлора. Идет эпитаксиальный рост фазы перовскита на текстурированной платине. Кристаллиты перовскита образуются на границе пленкаподложка и быстро прорастают через объем пленки за счет анизотропии роста (рис. 2, f) [1,3]. Одновременно происходит медленный рост количества нетекстурированного перовскита. Быстрый рост  $I_{(111)}$  сопровождается ярко выраженными оптическими эффектами. Увеличение  $I_{sc}$  (рис. 2, c) указывает на изменение морфологии поверхности. Оно наблюдалось с помощью оптического микроскопа и приводило к изменениям угловой зависимости рассеянного света  $I_{sc}$ . Возрастание угла, соответствующего максимуму рассеянного света  $\phi_{max}$ , можно связать с уменьшением среднего расстояния между отдельными рассеивающими центрами  $r_0$  из-за увеличения количества кристаллитов. По положению максимума определялось среднее расстояние между рассеивающими центрами  $r_0(t)$ 

$$r_0(\phi_{\max}) = \lambda / (4\pi \sin \phi_{\max}), \qquad (2)$$

где  $\lambda$  — длина волны падающего света.

Зависимость  $r_0(t)$  (рис. 3, *a*) аппроксимирована экспоненциальной зависимостью ( $\tau_f = 22$  s). Было определено изменение концентрации кристаллитов фазы перовскита на стадии быстрого роста (см. вставку на рис. 3, *a*)

$$n(t) \approx 0.25 r_0^{-2}$$
. (3)

Стадия медленного роста сопровождается качественным изменением морфологии поверхности, наблюдаемым при помощи оптического микроскопа. Замедление скорости бокового роста приводит к формированию лабиринтной структуры, что соответствует геометрическому переходу перколяционного типа и понижению размерности роста  $2D \rightarrow 1D$ . Рост  $I_{(111)}$  замедляется ( $\tau_s = 850$  s).



**Рис. 3.** Зависимости от времени отжига среднего расстояния между рассеивающими центрами  $r_0$  на стадии быстрого роста (a) и средней ширины полосок фазы перовскита в лабиринтной структуре *w* на стадии медленного роста (b). Экспериментальные точки аппроксимированы экспоненциальными зависимостями. На вставке — увеличение концентрации кристаллитов перовскита на стадии быстрого роста.  $T_{an} = 600^{\circ}$ С,  $T_{pyr} = 380^{\circ}$ С.

Изменение морфологии поверхности пленок приводит к увеличению  $I_{sc}$  и уменьшению  $\phi_{max}$  за счет роста среднего периода лабиринта гетерофазной структуры w,

$$w(\phi_{\max}) = \lambda / (4\pi \sin \phi_{\max}). \tag{4}$$

Экспериментальные данные w(t) (рис. 3, b) аппроксимировались экспоненциальной зависимостью ( $\tau_s = 870$  s). Полученные особенности были отнесены на счет медленной рекристаллизации перовскита, сопровождающейся медленным уменьшением доли пирохлора.

2.2. Исследования образцов с высокой температурой пиролиза. Отжиги при  $T_{\rm an} = 600^{\circ}$ С были проведены и для образцов с  $T_{\rm pyr} = 490^{\circ}$ С (рис. 4). Наблюдаемое изменение основных характеристик аналогично результатам для образцов с низкотемпературным



**Рис. 4.** Зависимости от времени отжига интенсивности рентгенографического максимума фазы пирохлора  $I_{(222)}(a)$ , интенсивности рентгенографического текстурного максимума фазы перовскита  $I_{(111)}(b)$  и интегральной интенсивности рассеянного света  $I_{sc}(c)$ . Схема основных стадий эволюции морфологии пленки в процессе отжига: d — задержки (D), e — быстрого роста (F), f — медленного роста (S). I — дефекты, 2 — пирохлор, 3 — текстурированный перовскит, 4 — нетекстурированный перовскит.  $T_{an} = 600^{\circ}$ С,  $T_{pyr} = 490^{\circ}$ С.

Таблица 1.	Параметр	ы, п	олученные	при	обработ	ке	экс-
периментальны	іх данных	для	частично	отож	женных	пл	енок
$(T_{\rm an} = 600^{\circ} {\rm C})$							

	$ au_f$ , s	$ au_s$ , s	$t_{d1}$ , s	$ au_{flpha},{f s}$	$ au_{slpha}$ , s	$t_{\rm cat}$ , s		
	$T_{\rm pyr}=380^{\circ}{ m C}$							
<i>I</i> <sub>(222)</sub>	-17	-125	32	14	178	65		
$I_{(111)}$	13	850	36	18	162	115		
Isc	12	890	18	33	119	140		
$r_0$	22	870						
	$T_{ m pyr}=490^{\circ}{ m C}$							
<i>I</i> <sub>(222)</sub>	-180	-1550	132	83	225	220		
<i>I</i> <sub>(111)</sub>	113	1230	83	90	278	245		
Isc	250	3160	85	101	362	240		

пиролизом, но с существенно большими постоянными времени (табл. 1).

В исходном состоянии практически отсутствовала аморфная фаза, и пленки состояли только из пирохлора и нетекстурированного перовскита. Увеличение длительности стадии задержки (рис. 4, *d*) может быть вызвано существенной потерей свинца при пиролизе. Вызванная этим стабилизация пирохлора [18] приводит к затруднению образования текстурированного перовскита. Кроме того, наблюдался медленный рост количества нетекстурированного перовскита.

Быстрый рост текстурированного перовскита от подложки затруднен (рис. 4, b), поскольку образовавшийся в процессе отжига нетекстурированный перовскит блокирует рост зерен перовскита в направлении, перпендикулярном поверхности пленки (рис. 4, e).

На стадии медленного роста (рис. 4, f) происходит постепенное преобразование пирохлора в текстурированный перовскит. Также наблюдался медленный рост количества нетекстурированного перовскита.

2.3. Іп situ измерения кинетики быстрого фазового превращения. Разработанные методы анализа оптических измерений позволили исследовать кинетику быстрого фазового превращения при  $T_{\rm an} = 650^{\circ}$ С, которую невозможно исследовать традиционными рентгенографическими методами (рис. 5). Изменение интегральной интенсивности рассеянного света измерялось непосредственно в процессе отжига одного образца. Очевидно, что в этом случае точность измерений значительно выше, чем для серии частично закристаллизованных образцов. Полученная величина  $t_{\rm cat}$ соответствует моменту времени, при котором заканчивается стадия быстрого роста перовскита и уменьшается размерность роста  $\alpha(2D) \rightarrow \alpha(1D)$ .

Изменение морфологии поверхности пленок в процессе изотермического отжига при  $T_{\rm an} = 650^{\circ}{\rm C}$  исследовалось с помощью оптического микроскопа в модифицированном термостате. Экспериментально удавалось различать области, соответствующие разным фазам [12]. Фазовый переход сопровождался ростом количества и размеров областей, образованных зернами текстурированного перовскита. В результате обработки кадров видеофильма была определена зависимость от времени доли площади, занятой фазой пирохлора (рис. 6), и вычислены параметры кинетики фазового превращения (табл. 2). Отметим, что они близки к параметрам, полученным из анализа интегральной интенсивности рассеянного света. Некоторое различие можно отнести на счет неполной воспроизводимости условий отжига, вызванной модификацией термостата.

Показано, что анализ in situ измерений интегральной интенсивности рассеянного света и эволюции морфологии поверхности пленок в процессе быстрого термического отжига позволяет исследовать кинетику фазового превращения пирохлор-перовскит без рентгенографических исследований. Получены параметры, характеризующие зародышеобразование и рост кристаллитов перовскита на различных стадиях фазового превращения.



**Рис. 5.** Измеренные непосредственно в процессе отжига интегральные интенсивности рассеянного света. Экспериментальные точки аппроксимированы зависимостью (1).  $T_{an} = 650^{\circ}$ С.  $T_{pyr}$  (°С): a - 380, b - 490.



**Рис. 6.** Изменение в процессе отжига доли поверхности пленки, занятой зернами перовскита. Экспериментальные точки аппроксимированы зависимостью (1).  $T_{an} = 650^{\circ}$ C,  $T_{pyr} = 490^{\circ}$ C.

**Таблица 2.** Параметры кинетики фазового превращения, полученные из анализа результатов in situ оптических измерений  $(T_{\rm an} = 600^{\circ}{\rm C})$ 

	$T_{\rm pyr}$ , °C	<i>t</i> <sub><i>d</i>1</sub> , s	$ au_{flpha}$ , s	$ au_{slpha}$ , s	$t_{\rm cat}$ , s
$I_{\rm sc}$	380	1.3	2.5	5.6	4.9
$I_{\rm sc}$	490	1.4	13	42	21
$S_{\rm per}/S_0$	490	-6.2	24	175	33

Адекватность метода подтверждена сопоставлением данных по рассеянию света и рентгенографических исследований серии частично отожженных пленок. Следует отметить, что предложенный in situ метод позволяет исследовать процесс фазового превращения в различных пленках, нанесенных на любые подложки с любыми нижними электродами. Использование метода позволит оптимизировать условия отжига для промышленного производства интегральных схем, содержащих сегнетоэлектрики.

Авторы благодарят D. Bolten, R. Gerhardt и R. Waser за пленки, предоставленные для исследований.

## Список литературы

- K.G. Brooks, I.M. Reaney, R. Klissurka, Y. Huang, L. Bursill, N. Setter. J. Mater. Res. 9, 2540 (1994).
- [2] J. Chen, K.R. Udayakumar, K.G. Brooks, L.E. Cross. J. Appl. Phys. 71, 4465 (1992).
- [3] E. Griswold, L. Weaver, M. Sayer, F. Czerwinski. J. Szpunar. Micron 26, 559 (1995).
- [4] M. Huffman, F.D. Gealy, L. Kammerdiner, P. Zurcher, J.C. Zhu, M. Al-Jassim, C.J. Echer. Ferroelectrics 134, 303 (1992).
- [5] M. Klee, P.K. Larsen. Ferroelectrics 133, 91 (1992).
- [6] A.P. Wilkinson, J.S. Speck, A.K. Cheetham, S. Natarajan, J.M. Thomas. Chem. Mater. 6, 750 (1994).
- [7] S. Trolier-McKinstry, J. Chen, K. Vedam, R. Newnham. J. Amer. Ceram. Soc. 78, 1907 (1995).
- [8] M. Libera, M. Chen. J. Appl. Phys. 73, 2272 (1993).
- [9] V.Ya. Shur, S.A. Negashev, E.L. Rumyantsev, A.L. Subbotin, S.D. Makarov. Ferroelectrics 169, 63 (1995).
- [10] V.Ya. Shur, S.A. Negashev, A.L. Subbotin, E.A. Borisova, S. Trolier-McKinstry. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 433, 351 (1996).
- [11] V.Ya. Shur, S.A. Negashev, A.L. Subbotin, E.A. Borisova. Ferroelectrics 196, 183 (1997).
- [12] И.П. Пронин, Н.В. Зайцева, Е.Ю. Каптелов, В.П. Афанасьев. Изв. РАН. Сер. физ. 61, 2, 379 (1997).
- [13] V.Ya. Shur, E.B. Blankova, A.L. Subbotin, E.A. Borisova, D.V. Pelegov, S. Hoffmann, D. Bolten, R. Gerhardt, R.J. Waser. Europ. Ceram. Soc. 19, 1391 (1999).
- [14] В.Я. Шур, С.А. Негашев, А.Л. Субботин, Д.В. Пелегов, Е.А. Борисова, Е.Б. Бланкова, С. Тролиер-Мак Кинстри. ФТТ 41, 2, 306 (1999).
- [15] А.Н. Колмогоров. Изв. АН СССР. Сер. мат. 3, 355 (1937).
- [16] M. Avrami. J. Chem. Phys. 7, 1103 (1939).
- [17] V.Ya. Shur, E.L. Rumyantsev, S.D. Makarov. J. Appl. Phys. 84, 1, 445 (1998).
- [18] C.V.R. Kumar, R. Pascual, M. Sayer. J. Appl. Phys. 71, 2, 864 (1992).